

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.В. Векасов

2020г

«19» 02

### Техническое задание на выполнение работ по футеровке ванн «Гальванического производства» ПАО «АСЗ»

В связи с необходимостью исключения воздействия химического состава на металлический корпус, продления жизненного цикла ванн гальванического производства цеха №1, необходимо выполнить защиту внутренней поверхности ванн, путем изготовления и монтажа футеровки из композитных материалов.

Применяемый материал должен быть устойчив к механическим воздействиям и химическому составу для каждой ванны в соответствии с таблицей №1.

Срок службы облицовки, при взаимодействии с используемым хим.составом, не должен быть менее 10 лет.

Работы по изготовлению заготовок, доставка к месту установки, монтажные работы выполняются силами и средствами подрядной организации.

Табл. №1. Технические характеристики оборудования.

П/П №	Наименование оборудования	Хим.состав	Габариты ДхШхВ
1	Ванна хим. обезжиривания участка травления	NaOH Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> * 12 H <sub>2</sub> O Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	6000x1000x2000мм.
2	Ванна травления участка травления	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	6000x1000x2000мм.
3	Ванна никелирования линии многослойного хромирования	NiSO <sub>4</sub> H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub> n-CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> SO <sub>2</sub> NH <sub>2</sub>	1500x800x1200мм.
4	Ванна хим. активации (декапирования) линии многослойного хромирования	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1500x700x1200мм.
5	Ванна эл/обезжиривания линии многослойного хромирования	NaOH Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> * 12 H <sub>2</sub> O	1500x700x1200мм.
6	Ванна эл/обезжиривания линии цинкования	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1500x700x1200мм.
7	Ванна электродекапирования линии цинкования	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1500x700x1200мм.
8	Ванна цинкования линии цинкования	ZnCl <sub>2</sub> , NH <sub>4</sub> Cl, Блескообр.-тель Леконда А,Б,С	1500x800x1200мм.
9	Ванна эл/обезжиривания линии цинкования-2	ZnCl <sub>2</sub> , NH <sub>4</sub> Cl, Блескообр.-тель Леконда А,Б,С	1500x700x1200мм.
10	Ванна электродекапирования линии цинкования-2	ZnCl <sub>2</sub> , NH <sub>4</sub> Cl, Блескообр.-тель Леконда А,Б,С	1500x700x1200мм.
11	Ванна травления линии подготовки	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1500x700x1200мм.
12	Ванна фосфатирования линии подготовки	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> Zn(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Zn <sub>3</sub> P <sub>2</sub>	1500x800x1200мм.

13	Ванна сернокислого оксидирования линии оксидирования		$H_2SO_4$	3000x990x2000мм.
14	Ванна твердого оксидирования линии оксидирования		$H_2SO_4$ $HOOC-COOH$	1300x500x800мм.

Разработал:

Зам. гл. энергетика

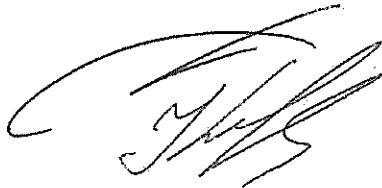


П.А. Вольных

Согласовано:

Начальник цеха №1

/ Главный энергетик



М.С. Панин

В.В. Чесноков